



等离子体聚对二甲苯的制备及其应用

<http://www.firstlight.cn> 2010-08-15

在研究等离子体聚合所合成的聚对二甲苯(ppPX)薄膜的化学结构和性能的基础上,考察了ppPX作为铜在Si--SiLK基体上阻隔层的应用可能性。在特定辉光射频条件下,ppPX膜表面的苯环能够保留。加热退火后,铜向裸Si--SiLK和向经ppPX接枝修饰的Si--SiLK基体的扩散程度存在差异。经由Ar和N₂载气所承载的对二甲苯单体所聚合得到的ppPX,具有不同的结构和性能,后者能改善铜和聚合物膜间的粘附力。因此,在Si--SiLK基底表面制备ppPX膜,可提高铜在基体上的粘附强度,又能阻隔铜向内基体内扩散。

[存档文本](#)